# 話題

# フィードフォワード制御によるハイパワー RF パルスの 振幅位相変調の実用化

川瀬 啓悟\*1·加藤 龍好\*1·入澤 明典\*1·柏木 茂\*2·磯山 悟朗\*1

## Practical Use of the Amplitude and Phase Modulation of a High-Power RF Pulse via Feed-Forward Control

Keigo KAWASE<sup>\*1</sup>, Ryukou KATO<sup>\*1</sup>, Akinori IRIZAWA<sup>\*1</sup>, Shigeru KASHIWAGI<sup>\*2</sup> and Goro ISOYAMA<sup>\*1</sup>

#### Abstract

A new feed-forward control system to precisely control the amplitude and phase of the pulsed RF power in an electron linear accelerator (linac) is developed to make the accelerating field constant. Fast variations and ripples in the amplitude and phase in the RF pulses are compensated by modulating the amplitude and phase in the low-level system with a variable attenuator and phase shifter. The system is innovated the overdrive technique, which is commonly used in analog circuits, to speed up the slow response of the phase shifter, while the control signals are digitally processed; thus, the method is a hybrid of analog and digital techniques. By using the new control system, we find that the peak-to-peak variations in the amplitude and phase are reduced from 11.6% to 0.4% and from 6.1 degrees to 0.3 degrees, respectively, in 7.6- $\mu$ s-long RF pulses for the L-band electron linac at Osaka University.

## 1. はじめに

現在、高エネルギー加速器の多くはバンチある いはバンチ列 (マルチバンチ) 状の荷電粒子を加 速するために RF 電場を用いている. そのため電 場の振幅と位相の長時間ドリフトと短時間変動は 粒子ビームの品質に非常に大きく影響する. 電子 線形加速器 (ライナック) はそのような加速器の ひとつであり、自由電子レーザー(FEL)などの様々 な応用のために高輝度電子ビームを供給すること ができる. 共振器ミラーを用いて光を閉じ込め, 増幅させる発振型 FEL と呼ばれる方式の FEL で は、等間隔の電子バンチ列から構成されるマルチ バンチ電子ビームを用いる. 光共振器内に設置さ れたウィグラーによって発生する光パルスは光共 振器内に蓄積され、後続の電子バンチと相互作用 することにより, FEL パワーが飽和するまで増幅 される. 常伝導 RF ライナックを用いた FEL はマ クロパルスと呼ばれる数マイクロ秒の長さのマル チバンチ電子ビームを用いる。発振型 FEL を動 作させるためには,電子ビームは次のような2 つの要求を満たさなければならない. 1)マクロパルス中のエネルギー広がりはFELゲ インバンド幅よりも十分に小さくしなければなら ない(数%以下)<sup>1)</sup>. ここでFELゲインバンド幅は 近似的にウィグラー周期数の逆数に等しい. 2)ミクロパルスと呼ばれる各バンチの間隔はバ ンチ長よりも十分に短い精度で等しくなければな らない. これらの条件を満たすためのRFシステ ムへの要求は,ライナックへ導入されるRFパワー の振幅と位相がマクロパルス内でそれぞれ1%, 1度以内で一定であり,変動がそれら以下となる ことである.

一般に、ライナックへ供給される RF パワーは クライストロンにより生成される.マクロパルス 中の振幅と位相の高い一様性と再現性は、クライ ストロンモジュレータによりクライストロンへ供 給される高電圧方形パルスが平坦で、その波高値 が高い再現性を持つ時に実現される.しかしなが ら、RF パルス中で振幅と位相を一定にする別の

<sup>\*1</sup> 大阪大学産業科学研究所 Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University (E-mail: kawase@sanken.osaka-u.ac.jp)

<sup>\*2</sup> 東北大学電子光理学研究センター Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University

方法がある. この方法は米国ブルックヘブン国立 研究所で開発され、自己適応フィードフォワード 制御を用いている<sup>2-4)</sup>. この方法では,マクロパ ルス中の RF パワーの振幅と位相は時間的にサン プリングされ、低レベル RF 回路において移相器 と可変減衰器により制御される。構築された制御 システムはその入出力に対して、ある決まった応 答行列を持つ.離散的な時間における位相と振幅 は、マクロパルス全体を通してそれらが一定とな るように、システムの応答の逆行列を用いること で変化させることができる. この方法はこれまで によく動作しており,一定の振幅と位相を持つ RF パルスの生成だけでなく, 過渡的なビームロー ディングの効果の補正に対しても利用され、いく つかの研究施設で採用されている<sup>5-9)</sup>.しかしな がら、この方法は完全にデジタル的で、変数が離 散的時間でのみ制御されるという欠点がある.

我々は大阪大学産業科学研究所の 40 MeV L バ ンド電子ライナックにおいて<sup>10,11</sup>,パルス RF パ ワーの振幅と位相を制御するための新しいフィー ドフォワード手法を開発した<sup>12,13</sup>. この手法はデ ジタルとアナログ技術の融合で,完全にデジタル 的なこれまでの手法の欠点を克服している. ここ では,我々が開発した新しい手法とその実験結果 を紹介する.

## 2. 振幅・位相の変動

常伝導ライナックの RF パワーはクライストロ ンで生成される. RF パワーの振幅  $A_k$  と位相  $\phi_k$ の変動はクライストロンによって印加された電圧  $V_k$ の変動を用いて次のように表現することがで きる<sup>14)</sup>.

$$\frac{\delta A_k}{A_k} = \frac{5}{4} \frac{\delta V_k}{V_k} \tag{1}$$

$$\delta\phi_{k} = -\frac{2\pi f_{RF}l_{k}}{c} \frac{\alpha}{\left[\left(1+\alpha\right)^{2}-1\right]^{3/2}} \frac{\delta V_{k}}{V_{k}} \qquad (2)$$

ここで $f_{RF}$ は RF 周波数,  $l_k$ はクライストロンのド リフト長, cは光の速さ,  $\alpha = eV_k/m_0c^2$ は静止質 量で規格化されたクライストロンで加速される電 子の運動エネルギーである. 大阪大学産業科学研 究所Lバンド電子ライナックで用いているクライ ストロン (Thales, TV 2022E)の RF 周波数は $f_{RF}$ = 1.3 GHz で,典型的なクライストロンのカソー ド電圧は, $V_k$  = 230 kV,  $l_k$  = 0.885 m である. 振幅変動 $\delta A_k/A_k$ が1%以下,位相変動 $\delta \phi_k$ が1度 以下という要求を満たすためには、クライストロ ン電圧のパルスごとの変動と方形パルスの平坦部 におけるリップルはそれぞれ0.8%と0.19%以下 でなければならない.

図1は8µsの長さを持つロングパルスモード におけるクライストロンパルス波形の測定結果を 示しており、図2はパルスごとの変動を示してい る. 平坦部のリップルは0.3%以下であり, 変動 は0.024%である、クライストロンパルスでのリッ プル測定値から評価される振幅と位相の変動は, それぞれ 0.38%と 1.6 度である. 一方, 加速管へ 送られるクライストロンで生成された RF パワー の振幅と位相を測定した結果を図3に示してい る. RFパワーの振幅は7.6 µsの間で11.6%変動, 位相は 6.1 度変動している。 クライストロン電圧 リップルから評価した振幅と位相変動に比べて. このような大きな変動が現れる原因は特定できて いない. これらの現象の考えうる原因としては, サーキュレータが RF パワーラインに挿入されて いないことによるクライストロンとライナックの



図1 ロングパルスモードにおいてクライストロンへ印 加される高圧パルスの波形.(a)全波形.(b)平 坦部を拡大.パルス波高は-230 kV でパルス幅 は8 µs. 平坦部のリップルは 0.3%以下である.

加速管との結合におけるインピーダンスの不整合 が考えられる.この大きな振幅と位相の変動の問 題を解決するために、本研究では、RFパルスの 振幅と位相の変動の再現性がとても高く、RFパ ワーのパルスごとの変動が小さいことから、 フィードフォワード制御を適用することを選択した.



図2 規格化されたクライストロン電圧のパルス波高分 布. ヒストグラムは測定データで、実線はヒスト グラムの最小自乗ガウスフィットで、標準偏差は 0.024%.

## 3. 制御システム

我々は大阪大学産業科学研究所にあるLバンド ライナックにフィードフォワード制御システムを 構築した. 図4はLバンドライナックのRFシス テムと振幅と位相のフィードフォワード制御のた めの低レベル RF システムのブロック図を示して いる. 1.3 GHz RF 信号は高安定シンセサイザ(基 準発振器)で生成され、その出力信号は1WCW 増幅器,200Wパルス固体増幅器を通して1.3 GHz, 30 MW クライストロンを駆動する. クラ イストロンモジュレータは高電圧方形パルスをク ライストロンへ供給し、このパルス長はクライス トロンモジュレータのパルス整形ネットワークの 段数を変えることで4 µs と8 µs のどちらかを選 択できる. RF パルスのタイミングとパルス長は 1W 増幅器と200W 増幅器の間に挿入されてい る RF スイッチで変化させることができる. クラ イストロンからの出力パワーはプリバンチャー. バンチャー.加速管へ送られる.

フィードフォワード制御のハードウェア回路は BNL や他の研究施設で用いられているものとほ とんど同じ構成である<sup>2,3),5),8)</sup>. 高速ダブルバラ ンスドミキサを用いた可変減衰器 (Analog Devices, IQ modulator を利用) とバラクタダイ



図3 クライストロンからの RF パルスにおいて測定された振幅と位相. (a),(b) はそれぞれ振幅と位相のパルス全体 の波形. (c),(d) はそれぞれの平坦部を拡大した波形. 7.6 μs の間で振幅は 11.6%変動しており,位相は 6.1 度 変動している. (b) における位相の階段状の変化は位相検出器の出力範囲が切り替わっていることによるもので ある.



図4 Lバンド電子ライナックの 1.3 GHz RF システムとフィードフォワード制御システムのブロック図.

オードを用いた移相器 (R&K, Analog Phase Shifter) が RF スイッチと 200 W 増幅器の間の低 レベル信号ラインに挿入されている. 実際に本研 究および現在Lバンドライナックの実験において 定常的に利用されているフィードフォワード制御 装置の写真を図5に示す.可変減衰器と移相器は. 2つの独立した出力を持つデジタル任意関数発生 器 (Tektronix AFG3022B) により制御される. RF 信号はクライストロンから加速管へ向かうパ ワーをモニターするための方向性結合器から取り 出され、ローパスフィルターを通った後、2つに 分配される. 信号のひとつは RF パワーの振幅を 測定するためにダイオード検波器に入力されてお り、別の信号は基準発振器からの RF 信号に対す る RF パワーの位相を測定するために高速位相検 出器に入力されている.ダイオード検波器の出力 信号はパワーメータを用いて CW モードで較正 されており、位相検出器の出力信号も可変長同軸 管を用いて CW モードで較正されている.ダイ オード検波器と位相検出器からの出力信号はデジ タルオシロスコープ (Tektronix DPO4104) で測 定され、測定データはユニバーサルシリアルバス (USB)で接続されたパーソナルコンピュータ(PC) へ転送される. RFの振幅と位相を平坦化するた めのフィードフォワード制御信号を作成するため に、測定データをもとに PC で演算され、その結 果を任意関数発生器に送る. これも USB を通し て PC へ接続されている.

オシロスコープと任意関数発生器はライナック のスタート信号から幾分遅延させた信号によりト



図5 RFパルスの振幅と位相を低レベルで変調する フィードフォワード制御装置.

リガーされる.本システムでは一度制御データが 任意関数発生器に設定されると、その後はトリ ガー信号のみで RF パワーの振幅と位相をフィー ドフォワード制御する.

## 4. フィードフォワード制御

#### 4.1 制御装置

フィードフォワード制御システムの構成要素を 個別に評価するために、まず位相検出器とダイ オード検波器を用いて低レベルシステムにおける 可変減衰器と移相器の静的な応答を測定した.図 6は可変減衰器(a)と移相器(b)に対する測定結 果を示している.基準値に対する相対振幅変化と 位相が任意関数発生器からの制御電圧の関数とし てプロットされている.相対振幅変化は、制御電 圧をおよそ0.5から3.5Vまで変化させた時に0 から4まで変化している.低振幅変化領域では2 次関数的に増加するが,高振幅変化領域において はわずかに飽和している.ダブルバランスドミキ サからできている可変減衰器は制御電圧に対して 線形に応答するが,出力信号を測定するためのダ イオード検波器の信号が低レベル領域においてパ ワーに比例することから,この振る舞いが生じる. 一方,制御電圧を増加させることにより位相は6 度変化している.図6(b)に見られるように移相 器の応答については,0から5Vの制御電圧の変 化に対して,位相は120度以上にわたる範囲に おいて,近似的に線形に応答している.振幅制御 応答と同様に,振幅はおおよそ10%変化している. これらの装置の動的な応答については、任意関 数発生器からの制御電圧の関数として測定した. 8  $\mu$ s の長さの方形パルスが各々の制御装置へ供給され,時間応答を制御パルスのパルス波高の関数として測定した. **図7**は可変減衰器(a)と移相器(b)の時間応答を示している.制御電圧は振幅に対して1.49 V,位相に対して2.0 Vのオフセット値に関する値が図中に記されている.振幅の立ち上がり,立ち下がり時間は8  $\mu$ s のパルス長よりも十分に短いが,位相はおよそ 1  $\mu$ s の時定数を持ちゆっくりと立ち上がり,立ち下がる.

#### 4.2 オーバードライブ

フィードフォワード制御システムにより RF パ ルスの平坦部における振幅と位相の速いリップル



図7 変調のために8µsの方形パルスで駆動された可変減衰器(a)と移相器(b)の動的応答.

と変動を低減する必要がある. リップルの周期が 100 ns のオーダーであるから,位相制御に対し ては,利用している移相器はそのようなリップル を低減するために十分な速さを持っていない. こ こで使用している移相器はバラクタダイオードに よる標準的なアナログ移相器であり,等価回路は 制御電圧のステップ入力に対する時間応答ととも に図8に示されている.立ち上がりは,移相器内 の大きな容量性要素のためにゆっくりとなってい る.図8に示した等価回路の時間応答は以下の微 分方程式により与えられる.

$$V_{in} = \tau \frac{dV_{out}}{dt} + V_{out} \tag{3}$$

ここで  $V_{in}$  は制御のための移相器への入力電圧で ある.  $V_{out}$  は容量性要素がない移相器の制御電圧 であり、これは RF 信号の位相あるいは位相シフ トに比例する.  $\tau = RC$  は時定数である. 時刻  $t_0$ でのステップ関数入力に対して式 (3) を解くこと で、出力電圧の立ち上がりは

$$V_{out}(t) = V_0 + (V_1 - V_0) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau}\right) \right]$$
(4)

と書くことができる. ここで V<sub>0</sub>は初期電圧,



図8 バラクタダイオードによる移相器の等価回路と計算による階段状の制御電圧の変化に対する出力電圧の応答.

36 J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 10, No. 2, 2013 - 106 -

 $V_{in} = V_1 \ \text{lt} \ t > t_0 \ \text{cd} \ \text$ 

応答時間補償方法を適用することにより、移相 器の応答の高速化が可能であり、この手法をオー バードライブと呼ぶ. 遅い移相器を用いて位相の 方形変化を生成するために,最大入力電圧 Vin =  $V_{\text{max}}$ を位相が目的値 $V_{out} = V_1$ と等しくなるまで 印加する. その後入力電圧を目的値 V<sub>1</sub>に変え, パルスの終端まで保つ. 同様の方法は, 位相を元 の値 $V_{out} = V_0$ に戻す時にも施される. 制御電圧 を $V_{in} = V_1$ から最小値に変え、その後出力電圧 が目的値  $V_{out} = V_0$  に戻った時に  $V_{in} = V_0$  とする. **図9**は上記のオーバードライブ制御した時の位相 検出器の出力と、測定された位相変化を生成する 移相器への制御電圧の入力波形を示している. 12度のステップ変化に対する位相信号の立ち上 がり時間と立ち下がり時間はそれぞれ 90 ns, 84 ns である. この波形を, 図7(b) に示された移相 器の通常の応答と比較することによって、小さな 位相変化に対する移相器の応答がオーバードライ ブにより固有のものよりもずっと速くできている ことがわかる.



この手法は、移相器と全システムの遅い時間応

図9 オーバードライブを用いて位相変化において方形 パルスを生成するための制御電圧に対する移相器 の応答.方形パルスでの位相の変化は12度である. 位相変化の立ち上がりと立ち下がり時間は図8に 記した通常の制御に対するものよりもずっと短く なっている.

答を克服するために時間の任意関数として位相変 化を生成するために拡張できる.移相器を用いて RFパルスの位相変動を低減するために、変動を 相殺するために必要な時間の関数として、制御電 圧を駆動する必要がある.このアルゴリズムは逆 モデルを基礎とした開ループ適応制御として知ら れており<sup>15-18)</sup>.

$$\delta V_{in}(t) = P^{-1} \left[ \delta V_{out}(t) \right] \tag{5}$$

により与えられる. ここで  $\delta V_{out}$  (*t*) は目的値から の測定出力信号の差,  $\delta V_{in}$  (*t*) は出力信号を生成 する以前の入力信号に対する  $\delta V_{out}$  (*t*) を相殺する ために加えられる入力信号,  $P^{-1}$  は式 (3) の右辺 で与えられる演算子であり,  $P^{-1} = (\tau \times d/dt + 1)$ である. よって相殺に対する入力電圧は比例項  $\delta V_{out}$  (*t*) にその微分  $\tau \times d (\delta V_{out} (t))/dt$  を足すこ とにより与えられる. この微分項は遅い時間応答 に対する補償のためのオーバードライブ項である.

4.3 システムの応答

フィードフォワード法によりハイパワー RF パ ルス中の振幅と位相の変動を補償するためには, 図4に示したハイパワー RF ラインを含む全シス テムの静的,動的応答を測定することが必要であ る.システムの静的応答は低レベルシステムと同 様に,制御入力基準値付近で可変減衰器あるいは 移相器の DC 制御電圧を変化させることで測定し た.測定信号は図3で見られるようなパルス構造 を持つので,任意関数発生器からの基準制御電圧 に対して得られた波形から差し引いて静的応答を 評価している.その結果を図10に示す.可変減 衰器の応答(a)は振幅飽和とクライストロンの特 性による制御電圧の増加に対する位相の変化が見 られる.一方,移相器の応答(b)は位相において 線形に変化し,クライストロンにおけるパワー飽 和のために制御電圧の増加に対して振幅は一定で ある.実際には,飽和よりわずかに下の動作点を フィードフォワード制御に対する基準動作点とし て選択している.

システムの動的応答を測定するために、RF シ ステムをロングパルスモードで動作させ、ハイパ ワー RF パルスの中心付近でパルス化された変調 を生成するために、4 µs の長さの方形パルスを 各々の制御装置へ印加した. 全システムの動的応 答は任意関数発生器からの制御方形パルス電圧の 関数として測定し、システムの振幅と位相の応答 は DC 基準制御電圧に対する応答からの相対変化 として評価した. 図 11 はオシロスコープと同時 刻に測定した任意関数発生器からの出力信号と合 わせて測定した時間波形を示している. 全システ ムの応答は、高速リップルが信号に残っているこ と, 飽和効果が振幅に見られること, 位相波形が 短い変調周期により一定値に達していないことを 除いて、低レベルシステムにおける制御装置のも のと同様である.

全システムの時定数は振幅と位相の測定された 波形への式(4)で与えられる容量性負荷の応答関 数の最小自乗フィットから導かれ,制御信号から



図10 可変減衰器(a)と移相器(b)を用いた全システムにおける振幅と位相制御の静的応答。静的応答は基準制御電 圧に対する波形に関してマクロパルス内の振幅と位相における変化の平均として定義される。基準値に対する 振幅ゲインと位相が制御電圧の関数としてプロットされている。



図 11 可変減衰器 (a) と移相器 (b) へ印加された 4 µs の方形パルスからできている制御電圧に対する全システムの 動的応答と遅延時間. これらは変調のない基準波形に関する振幅と位相の相対変化である. 図中に記されてい る振幅と位相に対する時定数と遅延時間はこれらの測定から導出され,フィードフォワード制御のために式(6) で用いられている.

測定された波形への遅延時間は**図 11** に記されて いるように得られる.時定数は振幅に対して $\tau$  = 0.11  $\mu$ s,遅延は $\Delta t$  = 0.37  $\mu$ s で,位相に対して  $\tau$  = 0.80  $\mu$ s, $\Delta t$  = 0.49  $\mu$ s であった.時間遅延 を考慮することで,式(3)は

$$V_{in}(t) = \tau \frac{dV_{out}(t - \Delta t)}{dt} + V_{out}(t - \Delta t)$$
(6)

と修正される.ここで測定された時定数が式(6) で用いられる.

#### 4.4 制御方法

フィードフォワード制御のための手法は以下の 通りである.初めに,振幅と位相の目標値(定 数)を与える.次に,クライストロンから加速管 へ進む RFパワーのモニター信号を方向性結合器 により取り出し,位相と振幅がオシロスコープに より数回測定される.測定されたデータはランダ ムノイズを低減するために平均化され,較正曲線 を用いて位相と振幅に変換される.振幅と位相の フィードフォワード制御のためのデータセットを 構成するために,目標値と測定された波形データ の差分を取る.結果の差分波形データは図10に 示されている全システムの静的な応答曲線を用い て可変減衰器と移相器に対する制御電圧へ変換さ れる.制御システムの遅延時間を補償するために 各々の制御波形データを-Δtだけシフトさせる. その時間微分を計算し,式(6)の右辺の第1項を 得るために時定数τと掛け合わせ,フィードフォ ワード制御のためのデータセットを生成するため に,時間シフトさせた制御波形をそれに加える. そのようなデータセットが任意関数発生器へ送ら れ,制御システムのタイミング信号でトリガーさ れることにより,フィードフォワード制御が開始 される.

振幅を可変減衰器で変化させた時,図10(a) で見られるように位相もまた変化する.そのよう な結合があるために,現在のところ,振幅と位相 の独立した制御は困難である.別の問題は図6と 図10で見られるような制御装置と全システムの 非線形振幅応答である.なぜなら,フィードフォ ワード制御によるリップルの補償はシステムの線 形応答を基礎としているからである.これらの困 難を克服するために,上記の補償方法を測定波形 が目標波形に等しくなるまで,振幅と位相に対し て数回交互に繰り返す必要がある.このようにし て,フィードフォワード制御のための振幅と位相 の制御データセットを生成する.この後,制御シ ステムはトリガー信号のみで駆動する.

## 5. 結 果

上記のハイパワー RF パルスの振幅と位相を一

定にするためのフィードフォワード制御手法の実 用性について、ロングパルスモードで動作するL バンド電子ライナックに対して実験的に研究し た.4.3節に記述したように、各々の制御装置の 結合とシステムの非線形性を補償するために、4.4 節に記述した制御操作を振幅、位相に対して交互 に反復し、それらの変動を低減させた.図12は 実験の結果を示している.これらの操作を数回繰 り返すことでマクロパルス内の振幅と位相の変動 はすぐに大きく減少し、振幅と位相は平坦で一定 の値に収束する.図13は反復回数の関数として プロットした平坦部における振幅と位相の変動を 示している.数回の反復で変動は小さくなり、そ の後,反復回数を増加させても,振幅と位相の変 動は一定値周辺に留まる.

図 14 は時間の関数として補正された RF マク ロパルス波形の振幅と位相の拡大を示している. フィードフォワード制御により,7.6 µs にわたっ て変動は振幅で 11.6%から 0.4%に,位相で 6.1 度から 0.3 度に減少されている.これらの状態は Lバンドライナックの条件に依存するが,少なく とも 1 日から 1 週間にわたる期間維持される.

# 6. まとめと結論

本研究において,平坦部で高い平坦度の振幅と 位相を持つハイパワー RF パルスのライナックへ



図 12 フィードフォワード補償の反復回数を増加させていった時の RF パルス中の振幅 (a) と位相 (b) の各波形の変化.



図13 反復回数の関数としてプロットした平坦部における振幅と位相のピーク変動.

-109 -

J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 10, No. 2, 2013 39



図14 5回の反復後のフィードフォワード法による振幅と位相の変動を減少させた最終結果

の供給を実現するための新しいフィードフォワー ド手法を開発した. ここでは、リップル周期と比 べて制御システムの遅い応答をスピードアップす るためにオーバードライブという手法を用いてい る.システムの非線形応答と、振幅と位相制御間 の結合による問題は必要に応じて反復制御法を適 用することにより解決された.結果として、大阪 大学のLバンド電子ライナックにおいて RF パル スの平坦部 7.6 µs において振幅変動が 11.6%か ら 0.4%に、位相変動は 6.1 度から 0.3 度にそれ ぞれ減少した. ここで開発した手法により、従来 のクライストロンモジュレータのパルス整形ネッ トワークを多段化して RF パルスの平坦度を上げ るという大規模な改修することなしに、低レベル RF ラインへ小規模なフィードフォワード振幅・ 位相制御装置を導入するだけで、高い平坦度の振 幅と位相を持つハイパワー RF パルスをライナッ クに供給することができるようになった.

## 参考文献

- G. Dattoli, A. Renieri and A. Torre, "Lectures on the Free Electron Laser Theory and Related Topics", World Scientific, 1993, p.326.
- 2) I. Ben-Zvi, J. Xie and R. Zhang, Proc. of the 1991 PAC, San Francisco, May 1991, p.1323.
- 3) R. Zhang, I. Ben-Zvi and J. Xie, Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A324 (1993) 421.

- 4) Y. Liu et al., Rev. Sci. Instrum. 68 (1997), 1137.
- 5) R. Hartley, I. Lehrman and J. Krishnaswamy, Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A375 (1996), ABS 22.
- F. Li and J. Xie, Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A407 (1998), 332.
- D. Li, et al., J. Infrared and Millimeter Waves 22 (2001), 1163.
- K-U. Kasemir et al., Proc. of 2005 PAC, Knoxville, May 2005, 1467.
- 9) K.H. Hu et al., Proc. of PAC 07, Albuqerque, June 2007, p.4258.
- S. Okuda et al., Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A358 (1995), 244.
- 11) R. Kato et al., Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A429 (1999), 146.
- 12) G. Isoyama et al., Infrared Physics & Technology 51 (2008), 371.
- K. Kawase et al., Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A679 (2012), 44.
- 14) H. Hogg and J.V. Lebacqz, in: Linear Accelerators, (P.M. Lapostolle and A.L. Septier eds.; North-Holland Publ. Co., Amsterdam, 1969), p.322.
- 15) B. Widrow and S.D. Stearns, "Adaptive signal processing", (Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1985).
- 16) B. Widrow and E. Walach, "Adaptive Inverse Control", (Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1995).
- 17) T. Czarski et al., Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. A568 (2006), 854.
- T. Czarski, "Complex Envelope Control of Pulsed Accelerating Fields in Superconducting Cavities", (EuCARD vol. 7, Publishing Office of Warsaw University of Technology, 2010).